

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成16年12月9日(2004.12.9)

【公表番号】特表2000-510514(P2000-510514A)

【公表日】平成12年8月15日(2000.8.15)

【出願番号】特願平9-540547

【国際特許分類第7版】

C 0 8 C 2/04

C 0 8 F 6/08

【F I】

C 0 8 C 2/04

C 0 8 F 6/08

【手続補正書】

【提出日】平成16年4月2日(2004.4.2)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年4月2日



特許庁長官 殿

1. 事件の表示 平成9年特許願第540547号

2. 補正をする者

名 称 シエル・インターナショナル・リサーチ・
マートスハツペイ・ベー・ヴェー

3. 代 理 人 東京都新宿区新宿1丁目1番11号 友泉新宿御苑ビル

(郵便番号 160-0022) 電話 (03)3354-8623

(6200) 弁理士 川 口 義 雄



4. 補正命令の日付 自 発

5. 補正により増加する請求項の数 なし

6. 補正対象書類名 請求の範囲

7. 補正対象項目名 請求の範囲

8. 補正の内容

(1) 請求の範囲を別紙の通り補正する。



[別 紙]

請 求 の 範 囲

1. イオン性汚染物を含有するポリマーセメントからイオン性汚染物を除去するための方法であって、
 - i) イオン性汚染物と反応する能力のある塩又は金属水和物である融解成分をポリマーセメントと接触させ；及び
 - ii) その様にして得たポリマーセメントから融解成分を分離することからなる前記方法。
2. 当該イオン性汚染物がリチウム、ニッケル及びアルミニウムイオンを含む請求項1に記載の方法。
3. ポリマーがポリブタジエン、ポリイソプレン、ブタジエン-イソプレンコポリマー、ブタジエン-スチレンコポリマー及びイソプレン-スチレンコポリマーからなる群から選択される請求項1又は2に記載の方法。
4. 融解成分が、融解成分のイオン性汚染物に対するモル当量比が5 : 1 ~ 100 : 1の範囲の量で存在する請求項1~3のいずれかに記載の方法。
5. ポリマーセメントを融解成分と50~80℃の範囲の温度で接触させる請求項1~4のいずれか一つに記載の方法。
6. 融解成分が重硫酸ナトリウム一水和物であり、イオン性汚染物がリチウムであり、そして重硫酸ナトリウム一水和物のリチウムに対するモル当量比が10 : 1~30 : 1の範囲にある請求項1~5のいずれか一つに記載の方法。
7. 接触が5分間~5時間の範囲の時間で実施される請求項1~6のいずれか一つに記載の方法。
8. ポリマーセメントがリチウム開始ポリマーをシクロヘキサン溶液中に含み、これを10分~2.5時間の範囲の時間に50~80℃の範囲内の温度で融解重硫酸ナトリウム一水和物と接触させ、その後、融解重硫酸ナトリウム一水和物とイオン交換した結果として減少したリチウム含量を有する上部ポリマー相を液-液相分離により得る請求項1~7のいずれか一つに記載の方法。